

対向陰極型マグネトロンスパッタ装置



本装置は、対向陰極型マグネトロンスパッタ装置で、2対の陰極を設置し、基板回転によって2種類の薄膜を交互に成膜が可能です。



対向陰極型マグネトロンスパッタ装置仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 成膜室径 内径φ260mm×500mmH SUS304 電解研磨
- スパッタ用電源 DC電源 120W 2台
- 基板形状 □10mm×1枚
- 膜厚分布 ±3%以内
- ターゲット寸法 2インチ(金属)
- ターゲット個数 4
- 移動可能距離 前後:40~80mm
カソード間:左右60~140mm
- 基板回転 有り
- 基板上下吊上機構 基板取付時チャンバ内部での交換取付は隙間がなく困難なため、
基板ホルダーをチャンバ上部に吊上げて基板交換が可能
- 基板加熱 常温~500℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 真空排気系 油回転ポンプ:333L/min(50Hz)
ターボ分子ポンプ:300L/sec
- 操作方法 自動/手動選択可能
- ガス系統 マスフローコントローラ 2系統
- ユーティリティ 電気:AC200V三相 5.0kVA
冷却水:5L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
寸法: 装置本体:1100mmW×700mmD×(1960)mmH